PAT-NO: JP362063610A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62063610 A

TITLE: TREATMENT OF GAS PRODUCED IN

METALLIC BATH GASIFYING

FURNACE

PUBN-DATE:

March 20, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHINANO, KUNIZO

ISHITOBI, CHITOSE

OISHI, KIICHIRO

FUKUDA, JUICHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME		COUNTRY		
SUMITOMO	HEAVY	IND	LTD	N/A
SUMITOMO	METAL	IND	LTD	N/A

APPL-NO: JP60203111

APPL-DATE: September 13, 1985

INT-CL (IPC): C21C005/40, F27D017/00

US-CL-CURRENT: 75/549

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the response characteristics of respective dampers and to obtain always the max. dust removal efficiency by constituting the dampers of primary and secondary Venturi scrubbers in such a manner that the openings

thereof can be varied and adjusting the respective opening degree according to the rate of the raw materials to be charged into a furnace and the internal pressure of the furnace.

CONSTITUTION: The amt. of the gasifying raw material such as coal to be charged from a gasifying raw material blowing device 1 into a gasifying furnace 14 is measured by a flow meter 2 and the supply rate of pressurized oxygen is adjusted according to the measured amt. of the raw materials to be charged; at the same time, the damper opening degree of the primary Venturi scrubber 20 is so set by a calculator 5 and a damper driver 19 that the differential pressure thereof is maintained in a specified range. On the other hand, the internal pressure in the throat part of the furnace 14 is detected and the damper opening degree of the secondary Venturi scrubber 23 is adjusted by a threat pressure controller 13 and a damper driver 21 to maintain the specified internal pressure of the furnace 14. The always max. dust removal efficiency is thus obtd. without generating a time lag with the fluctuation in the flow rate of the produced gas contg. fine dust at a high concn.

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-63610

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

43公開 昭和62年(1987)3月20日

C 21 C 5/40 F 27 D 17/00

104

A-6813-4K 7147-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称 金属浴ガス化炉における発生ガス処理方法

②特 願 昭60-203111

剱出 願 昭60(1985) 9月13日

⑫発 明 者 科 野 邦 蔵

田無市谷戸町2丁目1番1号 住友重機械工業株式会社田

無製造所内

⑫発 明 者 石 飛 千 歳

田無市谷戸町2丁目1番1号 住友重機械工業株式会社田

無製造所内

⑩発 明 者 大石 喜一郎

東京都千代田区大手町1丁目1番3号 住友金属工業株式

会社内

①出 願 人 住友重機械工業株式会

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

⑪出 願 人 住友金属工業株式会社

大阪市東区北浜 5 丁目15番地

四代 理 人 弁理士 久 門 知

最終頁に続く

明細音

1. 発明の名称

金属浴ガス化炉における発生ガス処理方法

2. 特許請求の範囲

金属浴ガス化炉を用いて石炭あるいは石炭液化 残渣炭素質等の原料をガス化して発生ガス中の粉 塵を除去する2段ペンチュリスクラバによる発生 ガス処理方法において、

前記原料のガス化炉内への投入量に応じて1次ベンチュリスクラバの差圧を一定範囲になるように1次ベンチュリスクラバのダンバ開度を設定し、かつ、ガス化炉炉口部の内圧を検出して、前記内圧を一定に保持するように2次ベンチュリスクラバのダン バ開度を製整するようにしたことを特徴とする金属浴ガス化炉における発生ガス処理方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、金属浴ガス化炉における発生ガス の除區効率を高めると共に、炉口部ガス圧力制御 の応答性を向上し、ガスエネルギー回収効率を高 める発生ガス処理方法に関する。

(従来の技術)

金属浴ガス化炉を用いて石炭あるいは石炭液化 残渣炭素質等の原料をガス化する際、高温かつ高 ダクト濃度のガスが発生する。

このようなガス化を行う方法としては従来の製鋼 技術、伝炉製鋼法が適用でき、第2図はその概要 このガス処理方法は、ガス を示すものである。 化炉 1 上に設置された ガスクーラー 15 により発 生ガスを冷却した後、一次ペンチュリスクラバ 20 を通して比較的大粒径の粉塵を補棄し、さら に2次ペンチュリスクラバ23により微細な舒麻 の除去を行い、このようにして清浄化されたほぼ 常温の発生ガスを誘引排風機25により吸引し、 · ガスホルダ(図示せず)に回収するものである。 ところで、転炉の場合と同様に、ガス化時に炉内 圧が変動する。 そこで転炉と同様ガス化炉1炉 口部に圧力調節計13を設置すると共に、2次ペ ンチュリスクラバ23のダンパ開度を可変とし、

11/30/04, EAST Version: 2.0.1.4

生ガスを回収する方法が採用できる。

このほか、転炉における2段ペンチュリスクラ パによる魔ガス処理方法としては、特公昭56-15684号公報、特公昭57-45447号公 報、特公昭57-58408号公報に示すように、 2次ペンチュリスクラパのダンパのみならず、1 次ペンチュリスクラバのダンパをも可変としたも のが開発されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前記第2図に示す処理方法であると、 2段ペンチェリスクラバのうち2次ペンチュリス クラバ23のダンパ開度のみが可変であり、1次 ベンチュリスクラバ 20'のダンパ崩度は固定され ている。 従つて、発生ガスの流量が増大すると、 炉口圧力と2次ペンチュリスクラバのダンパ開度 調整により2次ペンチュリスクラバ23の差圧 (△P₂)は減少するが、1次ペンチュリスクラ パ20'の差圧(△P₁)が増大してしまう。

ところが△P』を低下させるべく、2次ペンチ

公昭57-45447号公報、特公昭57-58 408号公報に示すものは、2次ペンチュリスク ラパのエルボセパレータと誘引送風機との間に設 けた流量計測用ペンチュリを通るガス流量に応じ て、1次ベンチュリスクラバのダンバ開度を決定 している。 しかし金属浴ガス化設備では、ガス の流量変動に対応させて1次ペンチュリスクラバ のダンパ開度をタイムラグなく調整すること(feed forward システム)が望ましく、前記公報記載の 技術は不適である。

この発明は、前記問題点を一揚すべく創案され たもので、1次ペンチュリスクラバのダンパと2 次ペンチュリスクラバのダンバとを可変とし、高 **濃度でかつ微細なダクトを含有する発生ガスの流** 量変動に対し常時最高の除塵効率を得ると共に、 前記各ダンパの応答特性を改良してタイムラグが 生じることのない金属浴ガス化炉における発生ガ ス処理方法を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

この発明は、金属浴ガス化炉を用いて石炭ある

炉口部の圧力の変動に伴いダンパを開閉して、発 ュリスクラバ23のダンパをさらに開くまでには タイムラグがあるため、発生ガスの約1.0%が燃 焼または海洩してしまう。 従つて前記ダンパの 開度調整に際しては、タイムラグを抑えることが 望ましい。

> また発生ガスの流量が減少すると、AP2は増 大するが△P」が減少する 2次ペンチュリスクラバ23の入口におけるダス ト濃度が増大し、除塵効率が低下してしまう。 このような一次ペンチュリスクラバのダンパ開度 固定による問題に対処するため、その期度を可変 としたものが前記公報に記載されている。 これ らは転炉用であり炉口付近での廃ガス流量の計測 が困難であるため、1次ペンチュリスクラバのダ ンパ開閉を feed back システムにより行つてい る。 すなわち特公昭 56-15684 号公報に 示すものは、1次ペンチュリスクラバ入口手前の 圧力と2次ペンチュリスクラバ入口手前の圧力と の差を検出し、この差圧に応じて1次ペンチュリ スクラバのダンパ隔度を決定している。 また特

> いは石炭液化残渣炭素質等の原料をガス化して発 生ガス中の粉塵を除去する2段ペンチュリスクラ バによる発生ガス処理方法である。 1次ペンチ ュリスクラバのダンパ開度の設定は、前記原料の ガス化炉内への投入量を流量計で計測し、該投入 量を演算器に入力して発生ガス流量を予め算出し、 1次ペンチュリスクラバの差圧を一定範囲にすべ く餌筋して行う。 また2次ペンチュリスクラバ のダンパ開度の設定は、ガス化炉炉口部の内圧を 圧力計で検出し、この内圧を一定範囲に保持すべ く調節して行う。

この発明の作用を、従来例のデータを参照して 説明する。 別喪1は各ペンチュリスクラバのダ ンパ開度、圧力損失(差圧)および集塵効率を示 したものである。

この表より、1次ペンチュリスクラバの圧力損 失を約500 maAqとし、2次ペンチュリスクラ パの圧力損失を1400~1600mm Aqとすれ は、最良の集塵効率(全効率)が得られ、さらに

1次V·S条件		2次V·S条件		v · s	築	盔	効	率	ΔP1
ダンパー開度	圧力損失	ダンパー開度	圧力損失	全圧力損失	1次V·S	2次V	• 8	全 劝 率	CF2
65%	100mmAq	30~40%	1590 mm Aq	1690 mm Aq	7 5.0 %	9 6	.0%	9 9.0 %	0.0 6 3
60%	150 mm A q	30~40%	1570 mm Aq	1720 mmAq	7 8.8 %	9 7	.2 %	9 9.4 %	0.0 9 5
5 5 %	200 mmAq	30~40%	1400 mmAq	1600mmAq	8 2.2 %	9 7	.9%	9 9.6 %	0.143
50%	3 5 0 mma A q	40~60%	1470 mm Aq	1820 mmAq	8 8.7 %	9.8	.6 %	9 9.8 %	0192
45%	500 mm A q	60~70%	1350mmAq	1850.mmA.q	9 0.3 %	9 8	.8 %	9 9.9 %	0.372

ガス流量 5000~6500Nm²/H(Dry) V • S入口ダスト濃度 20~40 9/H m²(Dry) V・Sの液/ガス比

なるので、2次ペンチュリスクラバにかかる負担 を低減できることがわかる。

次にこの発明における各ペンチュリスクラバの 開度設定について、別妻2を参照して説明する。

(i) 1次ペンチュリスクラバの開度設定

最大ガス流量に対しては、差圧(△Pi)が 最小の400mm Aqとなる様に、1次ペンチュ リスクラバの閉度を最大(70%)に設定する。 また、設計ガス流量に対しては、△P1 が基準 値の450㎜ Aqとなる様に、ペンチュリスク ラバを基準開度(50%)に設定する。 そし て最小ガス流量に対しては、△Piが最大の 5 0 0 mm A q となる様に、ベンチュリスクラバ の開度を最小(20%)に設定する。

(2) 2次ペンチュリスクラバの開度設定 2次ペンチュリスクラバの差圧(△P2)は 設計値に対するプロワーの静圧特性により決ま るものである. 今、設計ガス流量に対して (実施例) $\triangle P_2$ が 1 4 0 0 mm A q となるベンチュリスク

1次ベンチュリスクラバの集塵効率が約908と ラバの基準開度(508)を設定すれば、設計 静圧力が約−2000mmA qのプロワーにおい ては、△P₂ は最小ガス流量に対しては最小開 度(20%)で約1650mmAq、また最大ガ ス流量に対しては最大開度(708)で約1300 mm A qとなる。

> 従つて設計ガス流量、設定または変動最小ガ ス流量、简最大ガス流量に対しては、△Pi i ΔP_2 , ΔP_1 / ΔP_2 はおよそ別表 2 に示す 結果となる。

別 表 2

	差圧(△內)	差圧(ム門)	差圧の比 (ΔP ₁ /ΔP ₂)	$\triangle P$ $(\triangle P_1 + \triangle P_2)$
最大ガス流量	400 masAq	1300mmAq	0.3 1	1700mmAq
設計 "	450mmAq	1400 mm A q	0.3 2	1850mmAq
段小 "	500mmAq	1650 mm Aq	0.30	2.150mmAq

以下、この発明を図面に示す実施例に基いて説

明する。

.. . .

第1図はこの発明の発生ガス処理方法における 各装置と制御系を示す概要図であり、符号14は ガス化炉、20は1次ペンチュリスクラパ、23 は2次ペンチュリスクラバである。

石炭等のガス化原料は、吹込装置1よりランス 10を通りガス化炉14に送られるが、このとき 流量計2により投入量が計測される。 このデー タは発信器3より流量調節計4に送られ、演算器 5 に入力される。 演算器 5 は原料投入料に基い て発生ガス流量を算出し、1次ペンチュリスクラ パ20のダンパ開度を決定して、ダンパ駆動装備 19に信号を送る。 この信号によりダンパ駆動 装置19が作動し、もつて1次ペンチュリスクラ バ20のダンパ開度はSimulationされた発生ガ ス流量に応じて変化する。 なお、実施例では、 ガス化炉14の炉口部の温度データも、温度発信 器より演算器5に送られる。

一方、前記発信器3は、加圧酸素の流量調節計 6 にも信号を送る。 流量調節計6 には、この信

料投入量より算出した発生ガス流量で決定され 4. 図面の簡単な説明 るので、ダンパの応答性がきわめて良好であり、 従来のようにタイムラグが生じることがなく、 発生ガスの流量が変動しても1次ペンチュリス クラパの差圧は常に一定(400~500mmAq) に保持される。

- ② ①の理由により、1次ペンチュリスクラバの 除塵効率を90%以上に維持できる。
- ③ 2次ペンチェリスクラバの差圧も一定範囲 (1300~1650 mm Aq) に保持できるの で、一次ペンチュリスクラバの差圧と2次ペン チュリスクラバの差圧の比を一定 (△P1 / △P2 = 0.30~0.32) に保持し得、全体の除腐効 率も向上し、2次ペンチュリスクラバ出口含盛 **硬度をきわめて低く抑えることができる。**
- ④ 1次ペンチュリスクラバのダンパ開度も可変 であるので、2次ペンチュリスクラバのダンパ 開度調整範囲を狭くでき、その調整効果も高く なり、2次ペンチュリスクラバにかかる負担を 低減できる。

号のほか流量計9からのデータも送られる。 こ れらの信号、データに基いて流量調節計6から流 量調節弁8へ信号が流れる。 従つて原料投入量 に基いて必要量の加圧酸素もランス10よりガス 化炉14に送られる。 なお、原料投入量を流量 脚節計6に送る信号は、演算器5を介して行つて

また、ガス化炉14の炉口部分の圧力は圧力発 信器12で検知され、圧力調節計13に信号が送 られる。 さらに圧力調節計13からダンパ駆動 装置21を作動する信号が流れる。 従つて、2 次ペンチュリスクラバ23のダンパ開度は、炉口 部の圧力変動に応じて変化することになる。 従つて、この発明によれば、最良の集塵効率(全 効率)が得られ、2次ペンチュリスクラバ出口の 含塵濃度を低く(50mg/Nm²)抑えることがで き、また2次ペンチュリスクラバにかかる負担を 低減することができる(別表1,2参照)。

(発明の効果)

① 1次ペンチュリスクラバのダンパ開度は、原

第1図はこの発明の実施例を示す概要図、第2 図は従来例を示す概要図である。

1 ……原料吹込装置。 2 ……流量計 3 ……発信器, 4 ……流量調節計 6 ……流量調節計 5 …… 演算器 , 7 ……発信器, 8 ……流量調節弁 9 ……流量計, 10 ……ランス 11 ……発信器, 12 ……発信器 13 …… 圧力調節計, 14 ……ガス化炉 15 … … ガスクーラー , 16 ……洗浄塔 17 ……発信器。 18 ……差圧指示計

19 ……ダンパ駆動装置,

20 ……1次ペンチュリスクテバ,

21 ……ダンパ駆動装置, 22 ……差圧指示計

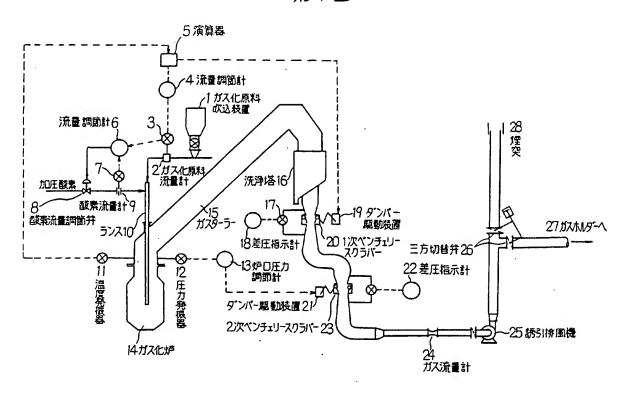
23……2次ペンチュリスクラバ,

24 ……ガス流量計 , 25……誘引排風機 27 ガスホルダ

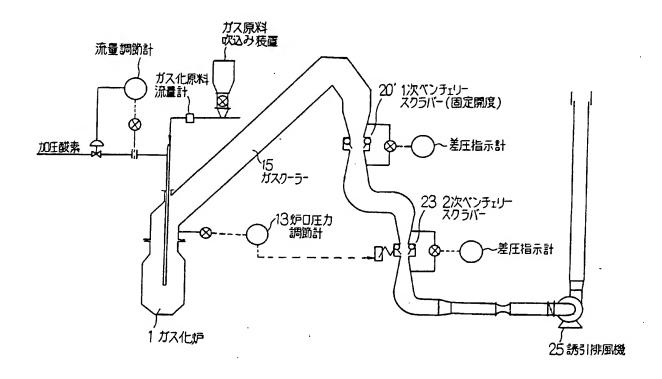
26 ……三方切换弁。

28 ……煙突

第1図



第2図



-49-11/30/04, EAST Version: 2.0.1.4

第1頁の続き

⑫発 明 者 福 田 充 一 郎 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 住友金属工業株式 会社内